

関係各位

2021 年 8 月 13 日

株式会社パテント・リザルト

## 【電力・ガス・石油】他社牽制力ランキング 2020

### トップ 3 は出光興産、大阪ガス、ENEOS

弊社はこのほど「電力・ガス・石油業界」を対象に、2020 年の特許審査過程において他社特許への拒絶理由として引用された特許件数を企業別に集計した「電力・ガス・石油業界 他社牽制力ランキング 2020」をまとめました。この集計により、直近の技術開発において競合他社が権利化する上で、阻害要因となる先行技術を多数保有している先進的な企業が明らかになります。

集計の結果、2020 年に最も引用された企業は、1 位 **出光興産**、2 位 **大阪ガス**、3 位 **ENEOS**となりました。

#### 【電力・ガス・石油業界 他社牽制力ランキング 2020 上位 10 社】

順位	企業名	引用された特許数
1位	<b>出光興産</b>	576
2位	<b>大阪ガス</b>	513
3位	<b>ENEOS</b>	415
4位	<b>中国電力</b>	362
5位	<b>東京ガス</b>	331
6位	<b>東京電力ホールディングス</b>	242
7位	<b>関西電力</b>	183
8位	<b>EXXON MOBIL</b>	128
9位	<b>中部電力</b>	96
10位	<b>東邦ガス</b>	94

※当ランキングは、企業グループを考慮した名寄せ処理を用いて算出しています。

#### 【ランキングの集計対象について】

日本特許庁に特許出願され、2020 年 12 月までに公開されたすべての特許のうち、2020 年 1 月から 12 月末までの期間に拒絶理由（拒絶理由通知または拒絶査定）として引用された特許を抽出。

本ランキングでは、権利移転を反映した集計を行っています。2021 年 5 月 1 日の時点で権利を保有している企業の名義でランキングしているため、出願時と企業名が異なる可能性があります。

なお業種は、総務省の日本標準産業分類を参考に分類しています。

1位 **出光興産**の最も引用された特許は「結晶質層及び非晶質層を積層してなる酸化物半導体膜を含む薄膜トランジスタ」に関する技術で、半導体エネルギー研究所の「半導体装置の作製方法」など計7件の審査過程で引用されています。このほか「高効率の有機エレクトロルミネッセンス素子」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、半導体エネルギー研究所の5件の拒絶理由として引用されています。

2020年に、出光興産の特許によって影響を受けた件数が最も多い企業は半導体エネルギー研究所(90件)、次いでトヨタ自動車(15件)、三菱ケミカル(13件)です。

2位 **大阪ガス**の最も引用された特許は「着色が著しく少ないフルオレン骨格含有アルコールの製造方法」に関する技術で、田岡化学工業などの計5件の審査過程で引用されています。このほかには「貯槽を内蔵すべき装置の隙間形状に合わせた自由な形状選択が可能な蓄熱槽」に関する技術が引用された件数の多い特許として挙げられ、大和ハウス工業などの計4件の拒絶理由として引用されています。

2020年に、大阪ガスの特許によって影響を受けた件数が最も多い企業はハーマン(24件)、次いで東京ガス(23件)、三菱電機(17件)となっています。

3位 **ENEOS**の最も引用された特許は「潜熱蓄熱材の機能発現を安定化・効率化するマイクロカプセル」に関する技術で、JSRの「蓄熱材の漏洩を抑制し、優れた蓄熱特性及び耐久性を有する成形体を与える組成物」関連特許など計3件の審査過程において拒絶理由として引用されています。

2020年に、ENEOSの特許によって影響を受けた件数が最も多い企業は出光興産(28件)、次いでトヨタ自動車、京セラ(いずれも12件)となっています。

4位 **中国電力**は「電気自動車に早く充電できる充電スタンド」が、5位 **東京ガス**は「性能や耐久性に優れ、排ガスに含まれる未反応の水素を有効に利用可能な燃料電池システム」が、最も引用された特許として挙げられます。

\* \* \*

また弊社では、ランキングデータを下記の通り販売しています。

#### 【電力・ガス・石油業界 他社牽制力ランキング 2020 データ】

▶納品物：以下のデータを収納した CD-ROM

- ・ランキング トップ 30 社：本業界の被引用件数上位 30 社のランキング
- ・被引用件数 トップ 100 件：本業界の被引用件数上位 100 特許、及び引用先の特許との対応

▶価格：50,000 円（税抜）

#### 【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社パテント・リザルト 事業本部営業グループ

TEL : 03-5802-6580 FAX : 03-5802-8271 HP : <https://www.patentresult.co.jp/>